

专利合作条约

发信人：国际检索单位

收信人： 518040 中国广东省深圳市福田区深南大道6021号喜年中心 A座1709-1711 深圳翼盛智成知识产权事务所(普通合伙)	<h2 style="margin: 0;">PCT</h2> <p style="margin: 5px 0;">国际检索单位书面意见</p> <p style="margin: 5px 0;">(PCT细则43之二 . 1)</p>	
国际申请号 PCT/CN2017/109090	国际申请日 (年/月/日) 2017年 11月 2日	优先权日 (年/月/日) 2017年 8月 18日
国际专利分类 (IPC) 或国家分类及IPC H01L 51/52(2006.01) i; H01L 51/56(2006.01) i		申请人 武汉华星光电半导体显示技术有限公司
申请人或代理人的档案号 TP170609-PCT		关于后续行为 见下面第2段
发文日 (年/月/日) 2018年 5月 17日		

<p>1. 本意见包括关于下列各项标明的内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 第I栏 意见的基础 <input type="checkbox"/> 第II栏 优先权 <input type="checkbox"/> 第III栏 不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见 <input type="checkbox"/> 第IV栏 缺乏发明的单一性 <input checked="" type="checkbox"/> 第V栏 按照细则43之二.1(a)(i)关于新颖性、创造性或工业实用性的推断性声明；支持这种声明的引证和解释 <input type="checkbox"/> 第VI栏 某些引用的文件 <input type="checkbox"/> 第VII栏 国际申请中的某些缺陷 <input type="checkbox"/> 第VIII栏 对国际申请的某些意见 <p>2. 后续行为</p> <p>如果提出初步审查要求书，本次意见将被视为国际初步审查单位(IPEA)的一次书面意见，除非申请人选择的国际初步审查单位非本机构，而且所选国际初步审查单位已按照细则66.1之二(b)通知国际局将不考虑国际检索单位的书面意见时例外。</p> <p>如本书面意见被视为国际初步审查单位的书面意见，则请申请人在自PCT/ISA/220表发文日起3个月或自优先权日起22个月内（以后届满者为准）向国际初步审查单位提交书面答复并提交修改（如适用）。</p> <p>进一步的选择参见PCT/ISA/220表。</p>

ISA/CN的名称和邮寄地址 中华人民共和国国家知识产权局 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088	完成本意见的日期 2018年 5月 10日	受权官员 安晶 电话号码 86-(10)-53962583
传真号 (86-10) 62019451	表 PCT/ISA/237 (扉页) (2015年1月)	

第I栏

意见的基础

1. 关于语言，本意见的制定基于：

国际申请提交时使用的语言。

该国际申请的_____语言译文，为了国际检索的目的提供该种语言的译文(细则12.3(a)和23.1(b))。

2. 本意见的制定考虑了本单位许可或被通知的根据细则91所做出的**明显错误更正**（细则 43之二1(a)）。3. 关于在国际申请中公开的任何**核苷酸和/或氨基酸序列**，本意见是基于下列序列列表做出的：a. 作为国际申请的一部分提交的：

附件C/ST.25文本文件形式

纸件或图形文件形式

b. 根据细则13之三.1(a)仅为国际检索目的以附件C/ST.25文本文件形式与国际申请同时提交的：c. 仅为国际检索目的在国际申请日之后提交的：

附件C/ST.25文本文件形式（细则13之三.1(a)）

纸件或图形文件形式（细则13之三.1(b)和行政规程第713段）

4. 另外，在提交/提供了多个版本或副本的序列列表的情况下，提供了关于随后提交的或附加的副本中的信息与申请时提交的作为申请一部分的序列列表的信息相同或未超出申请时提交的申请中的信息范围（如适用）的所需声明。

5. 补充意见：

第V栏 按细则43之二.1(a)(i)关于新颖性、创造性或工业实用性的推测性声明；支持这种声明的引证和解释

1. 声明

新颖性 (N)	权利要求	1-15	是
	权利要求	无	否
创造性 (IS)	权利要求	无	是
	权利要求	1-15	否
工业实用性 (IA)	权利要求	1-15	是
	权利要求	无	否

2. 引证和解释：

[1] 参考以下文献：

[2] D1: CN104167424A (26.11.2014)

[3] D2: CN106340523A (18.01.2017)

[4] 新颖性、创造性：

[5] 1、D1（参见说明书第[0062]-[0070]段、附图1）公开了一种柔性基底及其制备方法，其包括：提供第一塑料层，第一塑料层可为聚酰亚胺；在第一塑料层表面制备第一阻挡层，第一阻挡层可以由诸如Al₂O₃、SiO₂或SiN_x无机材料的单层或多层制成；在第一阻挡层表面制备第一中间层，第一中间层可以包括非晶硅；在第一中间层表面制备第二塑料层，第二塑料层可为聚酰亚胺。权利要求1与D1的区别在于：1）第一阻挡层为两层氧化硅层；2）在第一聚酰亚胺远离第一氧化硅层的一侧形成凹点阵列。权利要求6、11与D1的区别在于1）。因此，权利要求1-15具备新颖性，符合PCT33(2)。

[6] 2、对于上述区别技术特征1），在D1已经公开了第一阻挡层可以由诸如Al₂O₃、SiO₂或SiN_x无机材料的单层或多层制成的基础上，具体选择使用两层二氧化硅层作为第一阻挡层，是本领域的惯用技术手段；对于上述区别技术特征2），D2（参见说明书第[0043]段、附图1）公开了单层PI膜柔性基板10（即聚酰亚胺层）背离显示元件一侧的底面上形成有凹点图案，有利于应力的分散。因此，权利要求1、6、11不具备创造性，不符合PCT33(3)。

[7] 3、对于从属权利要求2-5, 7-10, 12-15，关于两层氧化硅层沉积设备、厚度以及密度的选择，是本领域技术人员的常规选择；在D2给出了柔性基板具有凹点的基础上，在两层聚酰亚胺层上均形成有凹点，是本领域技术人员容易想到的。因此，权利要求2-5, 7-10, 12-15不具备创造性，不符合PCT33(3)。

[8] 工业实用性：

[9] 权利要求1-15的技术方案可以在显示技术领域应用，具备工业实用性，符合PCT33(4)。